

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成18年3月23日(2006.3.23)

【公開番号】特開2004-281163(P2004-281163A)

【公開日】平成16年10月7日(2004.10.7)

【年通号数】公開・登録公報2004-039

【出願番号】特願2003-69314(P2003-69314)

【国際特許分類】

**H 0 1 M 4/04 (2006.01)**

**C 0 1 G 51/00 (2006.01)**

**H 0 1 M 4/02 (2006.01)**

**H 0 1 M 4/58 (2006.01)**

**H 0 1 M 10/40 (2006.01)**

【F I】

H 0 1 M 4/04 Z

C 0 1 G 51/00 A

H 0 1 M 4/02 C

H 0 1 M 4/58

H 0 1 M 10/40 Z

【手続補正書】

【提出日】平成18年2月6日(2006.2.6)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0015

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0015】

含フッ素化合物の容器基質との反応による溶着を抑制するため、上記セラミックス被覆層は、含フッ素化合物との化学反応性が低いスピネル、マグネシア、ジルコニアおよびアルミナの少なくとも1種からなることが好ましい。アルミナとしては、リチウムやフッ素との化学的反応性の乏しいアルミナが最適である。